

아이티비즈 (Korea)

EVG announces next-generation step-and-repeat nanoimprint lithography system - June 9, 2021

EVG announced the EVG®770 NT—its next-generation step-and-repeat NIL system. The EVG770 NT enables precise replication of micro- and nano-patterns for large-area master stamp fabrication used in high-volume manufacturing of AR waveguides, WLO and advanced lab-on-a-chip devices. "The EVG770 NT provides the missing link bridging free-form micro-optics or high-fidelity nanopatterning with cost-efficient large-scale production requirements. With this breakthrough step-and-repeat solution, our customers now have the ability to create their own master templates and bring the entire NIL process flow in-house, providing them with greater flexibility and faster turn-around on their production runs." stated Dr. Thomas Glinsner, corporate technology director at EV Group.

EVG그룹, 차세대 스텝-앤드-리피트 나노임프린트 리소그래피 시스템 발표

신속하고 효율적으로 생산 확장 가능



EVG770 NT 스텝-앤드-리피트 NIL 시스템

[아이티비즈 박채균 기자] EV그룹은 자사의 차세대 스텝-앤드-리피트 나노임프린트 리소그래피(NIL) 시스템 'EVG770 NT'를 출시한다고 9일 발표했다.

EVG770 NT는 증강현실(AR) 웨이브가이드, 웨이퍼 레벨 광학소자(WLO) 및 최첨단 랩온어칩 디바이스의 양산에 사용되는 대면적 마스터 스텝프 제작용 마이크로 및 나노 패턴을 정밀하게 복제할 수 있게 해준다.

지금까지는 스텝-앤드-리피트 NIL에 대한 추가적인 개발 및 생산 확장이 요구되더라도 보다 대면적의 정밀 마스터 스탬프를 구할 수 없어 확장에 제약이 생기는 경우가 많았다. 이러한 문제를 해소하기 위해, EVG는 NIL 및 스텝-앤드-리피트 마스터링 분야에서 수십 년 동안 쌓아온 경험을 토대로 새로운 EVG770 NT를 성능, 생산성 및 공정 제어 능력을 극대화할 수 있도록 완벽히 생산 지향적인 시스템으로 설계했다.

EVG770NT는 최대 300mm 웨이퍼 및 Gen-2 패널 크기까지 확장이 가능하며, 오버레이 정확도와 해상도를 제공한다. 그 결과 사용자는 양산 수준의, 비용 효율적이며 고충실도의 NIL 패터닝이 가능해졌다.

EV그룹의 기업 기술 디렉터인 토마스 글린스너 박사는 “EVG는 NIL의 제조 이점을 보다 다양한 시장과 애플리케이션에 제공하기 위해, 스텝-앤드-리피트 마스터링 기술의 개발 및 개선에 10년 넘게 투자해 왔다”며 “그 결과, 마이크로 광학소자 형성이나 고충실도의 나노패터닝을 비용효율적으로 대량생산할 수 있게 해주는 EVG770 NT를 선보일 수 있게 됐다”고 말했다.

저작권자 © 아이티비즈 무단전재 및 재배포 금지

<http://www.it-b.co.kr/news/articleView.html?idxno=50087>